## Ru(II)-Re(I)二核錯体と C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> のハイブリット光触媒の特性に対する Os(II)錯体光増感剤の添加効果

(東工大理)○田中 寿弥・榊原 教貴・静野 充彦・前田 和彦・玉置 悠祐・石谷 治 Additional effects of an Os(II)-complex photosensitizer on photocatalysis of a hybrid consisting a Ru(II)-Re(I) complex and C₃N₄ (School of Science, Tokyo Institute of Technology) ○Toshiya Tanaka, Noritaka Sakakibara, Mitsuhiko Shizuno, Kazuhiko Maeda, Yusuke Tamaki, Osamu Ishitani

Hybrid photocatalysts combining metal complexes and semiconductors have been attracted much attention owing to their high selectivity for  $CO_2$  reduction. We reported that the hybrid photocatalyst consisting of a Ru(II)-Re(I) supramolecule photocatalyst, a Ru(II)-complex-photosensitizer, and carbon nitride  $(C_3N_4)$  with high selectivity for  $CO_2$  reduction into CO with high turnover number. In this study, we used a photosensitizer with Os(II) as a central metal ion was introduced into the hybrid photocatalyst instead of the Ru(II) photosensitizer for improving absorption of longer wavelength in visible region. We newly synthesized the Os(II) complex with methylphosphonic acid as anchor groups for adsorbing on the  $C_3N_4$ , of which absorption edge is  $\lambda \sim 730$  nm, much longer than that of the Ru complex (Figure 1). Photocatalytic activity of the hybrid with this Os(II) complex as the photosensitizer will be also reported in this presentation.

Keywords: hybrid photocatalyst, CO<sub>2</sub> reduction, Os(II) complex, carbon nitride

近年、光酸化力に優れた半導体と  $CO_2$  還元選択性に優れた金属錯体を組み合わせたハイブリッド光触媒が注目されている。当研究室では、半導体光触媒カーボンナイトライド( $C_3N_4$ )と Ru(II)-Re(I)超分子光触媒を組み合わせたハイブリッド光触媒  $^{11}$ に、Ru(II)錯体光増感剤を導入するとターンオーバーナンバーが向上することを見出して

いる。本研究では、長波長側の吸収端が約 600 nm までしかない Ru(II) 錯体光増感剤の代わりに、高い重原子効果により長波長側に強い S-T 吸収を有する Os(II)錯体を光増感剤として用いたハイブリッド光触媒の開発を目指した。 アンカした Os(II)錯体の合成に成功可視光を効率よく吸収する (Figure 1)。当日は、この Os(II)錯体光増感剤を列走、一個大力では、一個大力を表現した。

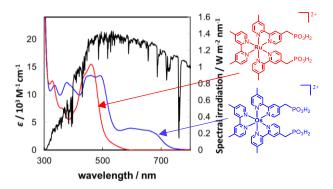


Figure 1 今回合成した Os(II)錯体(青)と 対応する Ru(II)錯体(赤)の吸収スペクトル 及び太陽光波長分布(黒)

1) K. Wada, C.S.K. Ranasinghe, R. Kuriki, A. Yamakata, O. Ishitani, K. Maeda, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 28, 23869–23877.